

回転円板法による脱窒と有機物除去に関する2,3の考察

宮崎大学 学の足立哲伸, 正 渡辺義公, 正 石黒政儀, 正 増田純雄

1. はじめに 筆者らが先に提示した回転円板法の定常動力学理論は、付着生物膜が常に液本体内に存在し液本体基質濃度が定常となれば生物膜内の基質濃度分布も定常となることを前提として導かれた。しかしながら円板を半水没として生物反応を生じさせる場合、付着生物膜は液相と気相を交互に循環しながら基質の供給と消費を繰り返している。このため生物膜内の基質濃度分布は絶えず変動しており厳密な意味での定常状態は存在しない。本文では硝化菌等の好気性生物膜と著しく性状の異なる通性嫌気性脱窒菌の生物膜を用いて本理論が半水没型回転円板法に適用可能であるかを論すると共に脱窒に伴う有機物除去特性についても検討する。

2. 実験および実験条件 実験装置諸元を表-1に示す。本研究には同一寸法の装置を2台用いた。円板上に脱窒菌が付着生育した時点で水位を下げる浸漬率(A_w/A_0)を50%とし、一方を円板上にカバーを取り付け大気閉鎖型(Close unit)とし、他方を大気開放型(Open unit)として用いた。Open unitには脱窒菌上に好気性栄養細菌層を形成させるために剛柔を行なった。実験条件を表-2に示す。設定期流入N₂O₃濃度50ppm、水素供与体にメタノールおよびグルコースを各条件に従って添加した。各Runとも流速負荷Q/Aをパラメータにとり1.0~30m/hの範囲で変化させた。また槽内設定温度はRun0よりRun11は30℃と25℃それ以外は全て25℃である。

3. 実験結果と考察 Riemerによれば脱窒の場合、生物膜内をN₂O₃が律速とする条件は液本体のC/N比 ≥ 2.24 である。図-1,2にClose unit(O₂分压 $\sim 1\%$)とOpen unit(O₂分压 $\sim 21\%$)と流速C/N比の関係を示す。Close unitではO₂分压が低いため生物表面でも液本体C/N比に逆比が保持されていると考えられる。

2. 生物膜内にはCH₃OHの浸入深さがC/Nのそれを上回るN₂O₃律速の状態にある。低負荷では供給されるNO₃-Nはほぼ完全に除去され残余CH₃OHが比較的高い平衡濃度となるためCe/Nelは高くなる。O₂/Aの増加に従い流出濃度が流入濃度に近づくため添加物に収束してゆく。Open unitの場合も栄養細菌層で換取されるCH₃OHが多いため嫌気性生物膜表面ではC/N<2.24となる。つまりN₂O₃律速の条件を保ち得ないとと思われる。図-3にCeとT-N Fluxの関係を示した。破線は図-6で得られたものである。明らかに最大脱窒速度に達してい

表-1 実験装置諸元			
円板直径	160 mm	UNIT/O	9.25 l
円板厚	3 mm	容積	
円板間隔	18 mm	UNIT内の 盤面積	0.175 m ²
円板枚数	13	盤面積	0.092 m ²
全円板表面積	0.523 m ²	円板回転数	15 rpm

表-2 実験条件				
有機炭素源	RUN NO.	C/N	A _w /A ₀	
METHANOL	0-1	3	100	
	0-2	3	100	
	1-1	3	50	OPEN
	1-2	3	50	CLOSE
	2-1	4.5	50	OPEN
	2-2	4.5	50	CLOSE
	3-1	6	50	OPEN
	3-2	6	50	CLOSE
GLUCOSE	4-1	6	50	OPEN
	4-2	6	50	CLOSE
	5	3	50	CLOSE

(b) C/N: 濃度比 T-N: NO₂-N+NO₃-N
A_w/A₀: 浸漬率(%)

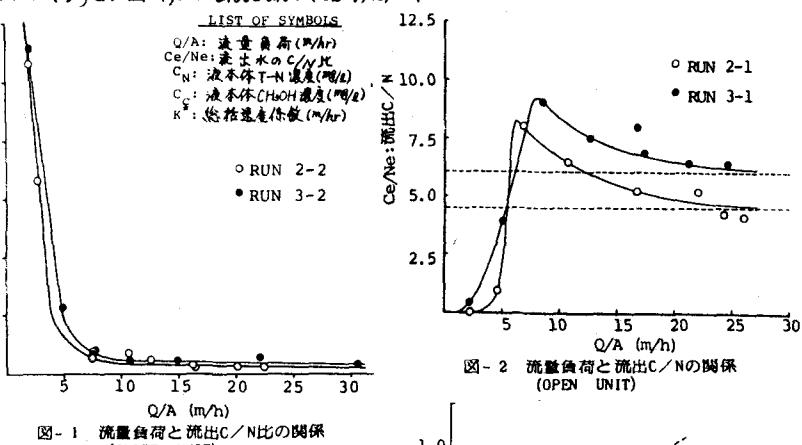
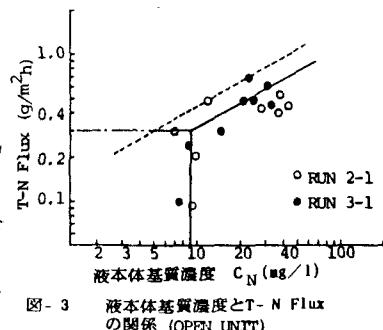


图-2 流量負荷と流出C/N比の関係 (OPEN UNIT)



いことがわかる。図2,3によれば低負荷ではCH₃OHの大部分は他栄養細菌層で摂取されるため脱塩速度が著しく小さくなっている。%Aを上げれば図-2でも図-1と同様に添加%値に収束するが脱塩速度は最大脱塩速度には達しない。これはOpen unitの好気的条件下では嫌気性生物層が不安定な状態になると思われる。

図-2-1が%A=67.5%/hでT-N Flux=0.3/m²/h, Run-3-17は%A=84.3%でT-N Flux=0.3/m²/hであり図-3のT-N Flux=0.3/m²/hに対するCu(9%)で脱塩速度が急に上昇するがこれはCH₃OHの浸入深さが酸素のそれを上回り嫌気性生物層に達するためと考えられる。図-4,5にT-N FluxとCH₃OH Fluxの関係を示す。図-4のRun0-1はT-NとCH₃OHのFluxの比が理論値($24\frac{\text{gCH}_3\text{OH}}{\text{gN}_2\text{O}_3}$)にほぼ等しい $2.5\frac{\text{gCH}_3\text{OH}}{\text{gN}_2\text{O}_3}$ とされているがRun3-27はこれよりわずかに高くO₂分圧が低くとも好気的に摂取されるCH₃OHがあることがわかる。図-5はOpen unitの場合である。Run2-1, 3-1のデータは完全に一致している。このOpen unitでは好気的に摂取されるCH₃OH Fluxと脱塩に用いられるその合計となる。好気的に摂取されるCH₃OH Fluxを評価するためにNO₃-Nを添加しない人工基質で実験を行なうとところ平均CH₃OH Fluxは約0.85/m²/hとなつた。これは図-5から得られる $3.4\frac{\text{gCH}_3\text{OH}}{\text{m}^2\text{h}}$ より先の $2.5\frac{\text{gCH}_3\text{OH}}{\text{m}^2\text{h}}$ を差引いた値とほぼ等しい。この関係はT-N Flux 0.3/m²/h以上で成立しており、この値以下では成立せず好気的に摂取されるCH₃OH Fluxは減少している。これは低負荷では他栄養細菌層CH₃OHが不完全浸透となるためと思われる。以上のことから嫌気性窒素と有機物を含む废水をOpen unitで処理する場合、脱塩層表面でC/N ≥ 2.24 を満足するように操作を行えば脱塩と好気性酸化による有機物除去を同時にしつつも効果的に行なうことができる。図-6:全水没およびbase unitのC/NとT-N Fluxの関係を示す。半水没型でT-N Fluxの場合は1/2次反応を呈することが明らかであり、著者らの理論が半水没型回転円板法に適用し得ることが確認された。図-7は全水没型での液体基質平衡CH₃OH濃度とCH₃OH Fluxの関係である。CH₃OHの浸入深さがNO₃-Nよりも深いのでNO₃-N律速となるため、1/2次反応が現われている。図-8:液体基質濃度C/Nと脱塩速度係数Kの関係を示す。C/N=0ではK=k_a=9%の関係より脱塩速度の計算を行うと本研究において生かす限りは約50μmとなる。この値は回転円板法による消化で、T-N値とほぼ等しい。

参考文献1) 渡辺,石黒,西畠;回転円板脱塩槽の動力学的解析 土木学会論文報告集 第270号, 1978年8月pp.45~43

2) Riemer; Kinetics of Denitrification in Submerged filter, Ph.D.Thesis, part 1, 1977 Technical University of Denmark pp.55~59

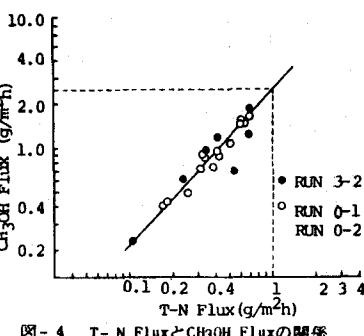


図-4 T-N FluxとCH₃OH Fluxの関係

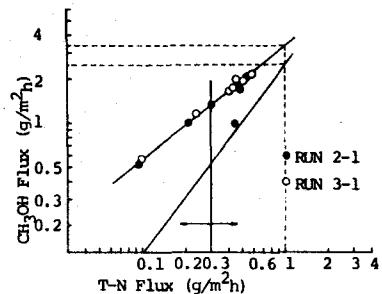


図-5 T-N FluxとCH₃OH Fluxの関係
(OPEN UNIT)

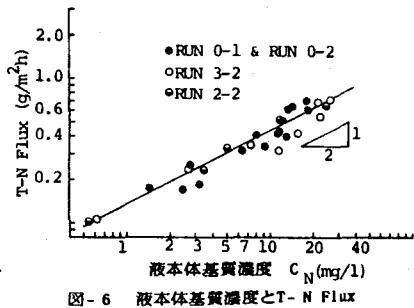


図-6 液体基質濃度とT-N Fluxの関係

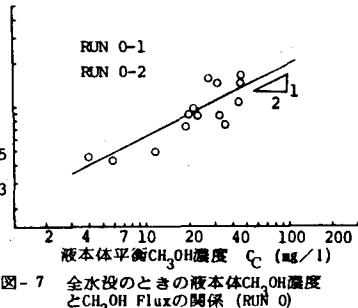


図-7 全水没のときの液体基質CH₃OH濃度とCH₃OH Fluxの関係 (RUN 0)

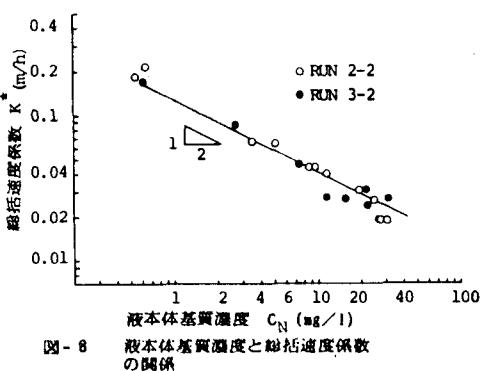


図-8 液体基質濃度と脱塩速度係数の関係